DLC 成膜用低圧 C2H2 プラズマ特性に及ぼす 外部パラメータ依存性の数値解析

Numerical Analysis of External Parameters Dependence on Properties of Low-Pressure C₂H₂ Plasma for Deposition of Diamond-Like Carbon Films

千葉工業大学¹, °(M1)佐々木 瞬¹, (M2)石井 晃一¹, 小田 昭紀¹

Chiba Institute of Technology¹, S. Sasaki¹, K. Ishii¹, A. Oda¹ E-mail: s17a4056wf@s.chibakoudai.jp

1. 背景

ダイヤモンドライクカーボン (DLC) 膜は, 高硬度, 耐摩耗性などの特徴を有することから切削部品やしゅ う動部品などに利用されている。この DLC 成膜には, 減圧下で炭化水素ガスをプラズマ化させ成膜する低圧 プラズマ CVD 法がよく用いられている^[1]。その際, 成 膜用ガスとして C₂H₂を用いた場合, 炭化水素ガスであ る CH4 と比較して成膜速度および膜硬度が改善される ことが報告されている^[2]。しかし,実験条件の変化に 伴う C₂H₂ プラズマ中の粒子種や電子温度などのプラ ズマ特性に及ぼす影響は未解明な部分が多い。

そこで本研究では、低圧高周波 C₂H₂プラズマの空間 1次元流体モデルの構築した上で、本モデルによるシ ミュレーションを行い、外部パラメータ(ガス流量、 ガス圧力、入力電力など)がプラズマ特性に及ぼす影 響について解析を行った。

2. 解析手法

本研究では、プラズマ中における粒子の挙動を流体 とみなし、数密度連続の式、ポアソンの式、電子エネ ルギー保存式からなる疑似熱平衡近似に基づく空間1 次元流体モデルを構築した。Fig.1に、本モデルにおけ る電極構成を示す。2枚の平板金属電極(ϕ 126 mm) を3 cmの間隔を空けて平行に配置した。その後、放電 空間内に C₂H₂ ガスを流量10~200 sccm で導入し、チ ャンバ内の全ガス圧力を 40 Pa 一定となるように排気 を考慮した。その上で、両金属電極間への150 W の電 力を投入したと設定した。ここで、本モデルでは、21 種類の荷電粒子、12 種類のラジカル、7 種類の非ラジ カルの計 40 種類の粒子種が本プラズマ中に存在する とし、これら粒子種による計 106 種類の反応過程を考 慮して解析を行った。

3. 結果および考察

Fig. 2 に,ガス流量を 10~200 sccm で変化させた際 の C₂H₂ プラズマ中の正イオン数密度の空間分布を示 す。本図より,流量を 100 sccm まで増加させると炭素 を 6, 8, 10 個含む高次イオン ($C_6H_4^+$, $C_8H_2^+$, $C_{10}H_6^+$) 数密度が 10⁸~10⁹ cm³のオーダーで表れる。更に流量 を 200 sccm まで増加させると、 $C_{12}H_6^+$ の顕著な増加が 確認できる。これは、 C_2H_2 の流量の増加に伴い、イオ ンの重合反応で主に消費される $C_2H_2^+$ が多く生成さ れ、重合反応が促進されたためと考えられる。イオン の重合反応で $C_2H_2^+$ に次いで消費される $C_4H_2^+$ が、流量 の増加に伴い減少していることからも反応の促進が示 唆された。その他結果については講演当日に報告する。



Fig. 1 Schematic diagram of low-pressure radiofrequency C₂H₂ plasmas model.



Fig. 2 Gas-flow rate dependence of positive ions number density in C_2H_2 plasmas.

	文 献
[1]	鈴木 雅裕 他:表面科学, Vol. 25, No. 4, pp. 232-237 (2004)
[2]	崔 埃豪 他:トライボロジスト, Vol. 62, No. 3, pp. 228-235 (2017)